

**NAR Labs** 國家實驗研究院

# 國家奈米元件實驗室

## 可變形束電子束曝光機 系統簡介

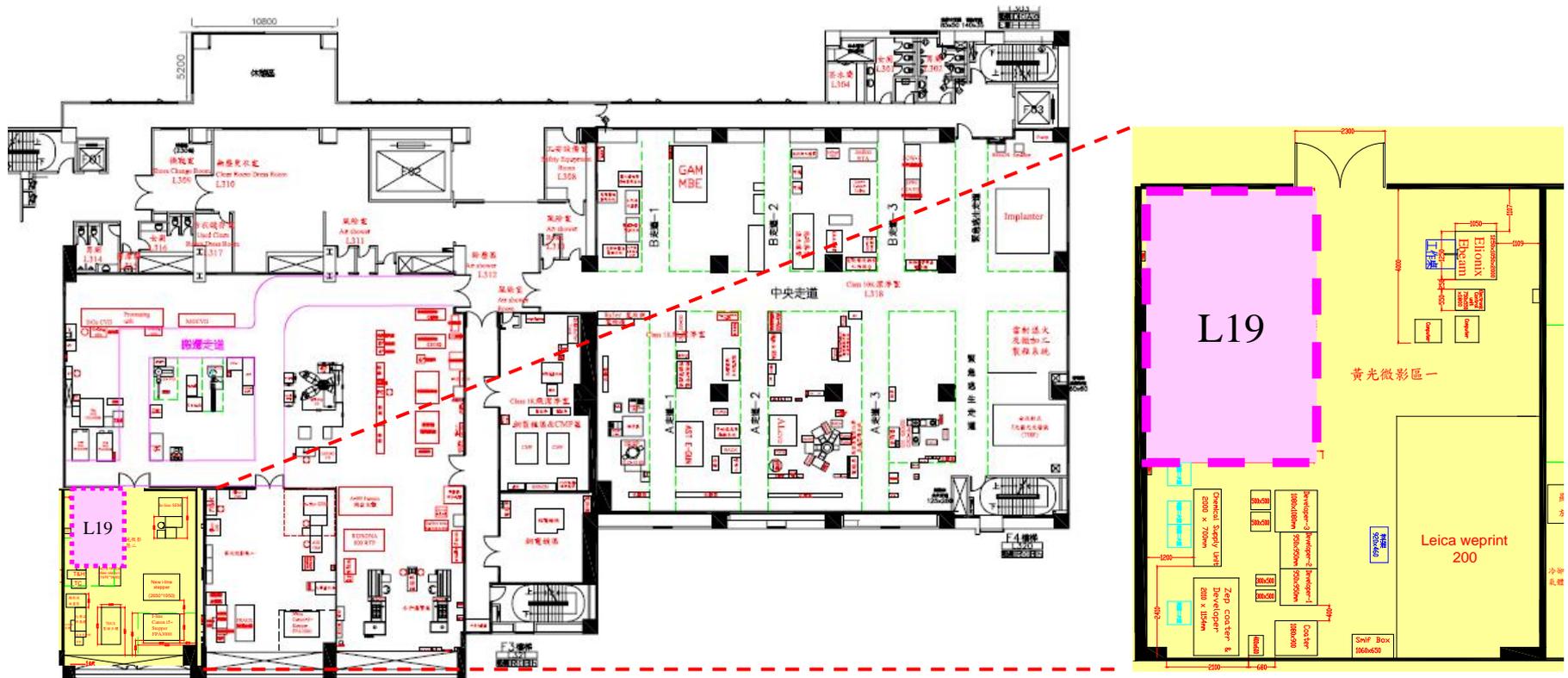
儀器編號：CF-L19

廠牌：VISTEC

型號：SB350

# 設備位置

奈米電子大樓  
無塵室100(黃光室)  
及下方之sub fab



實驗棟三樓平面圖

# 系統功能

**NAR**Labs

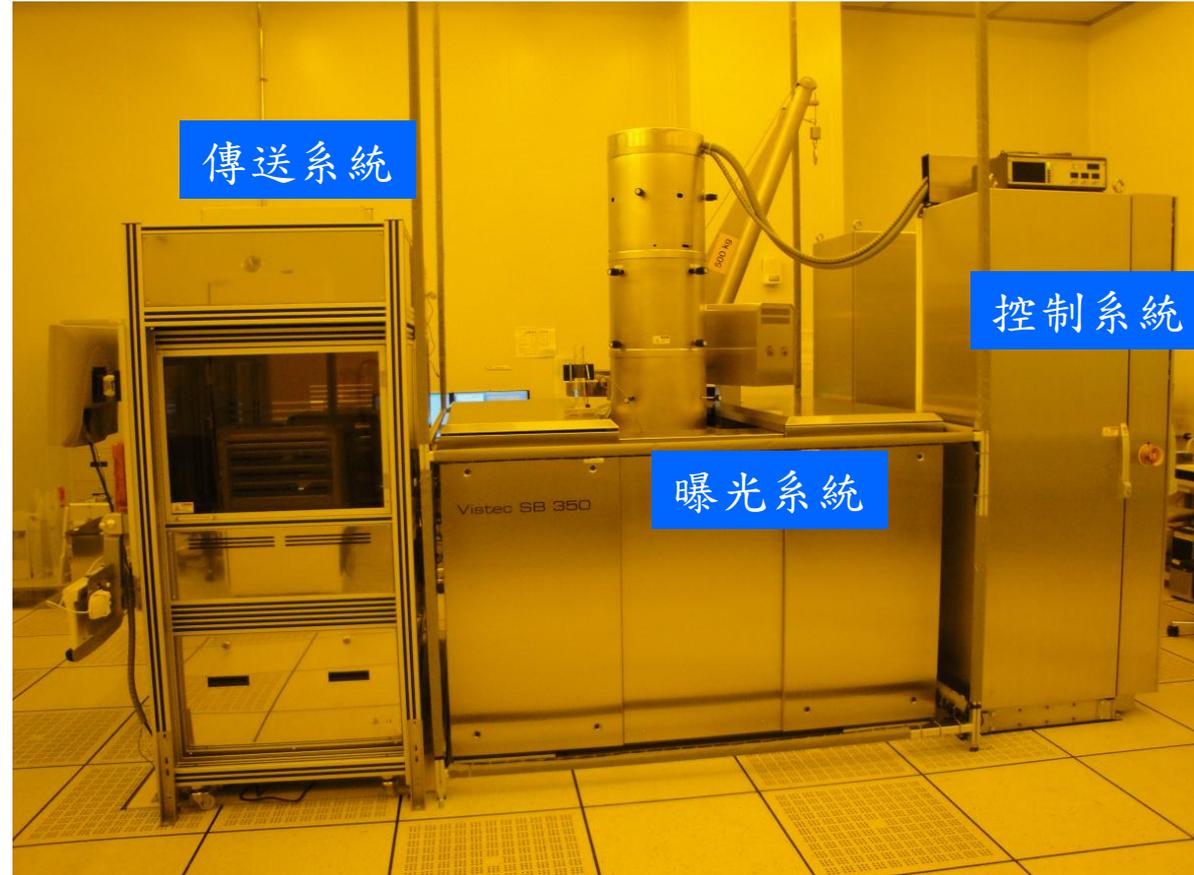
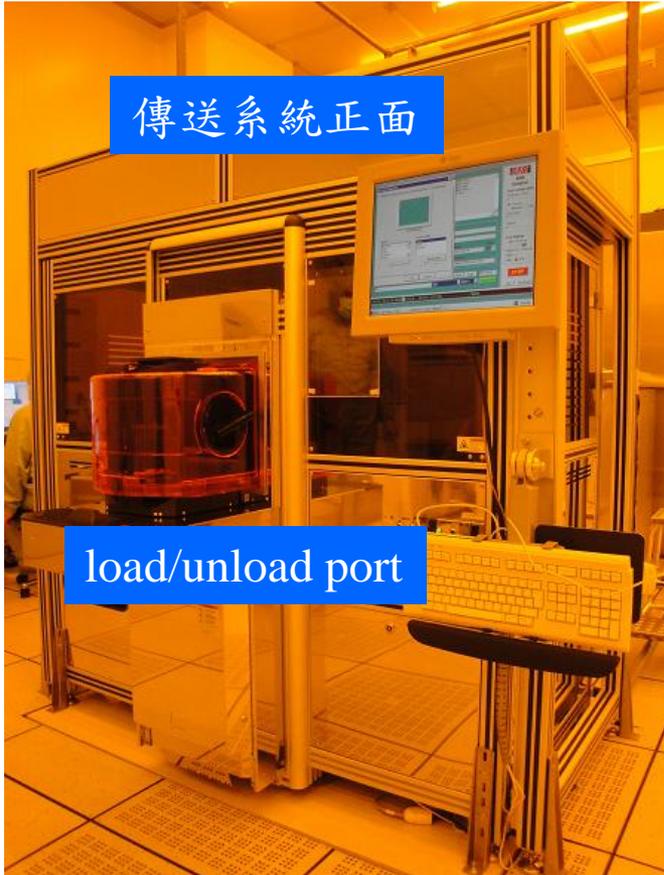


可變形束電子束曝光機功能為執行8吋晶圓曝光作業，主要規格如下：

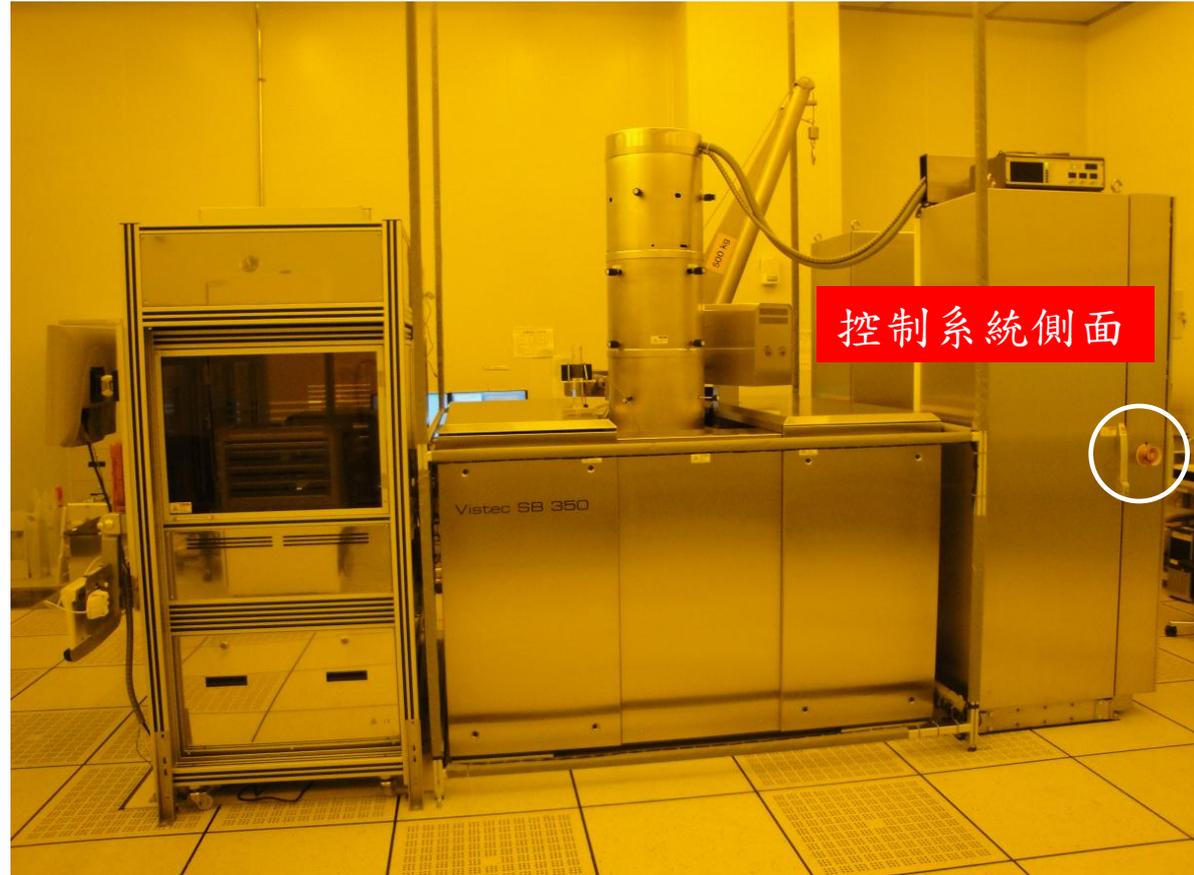
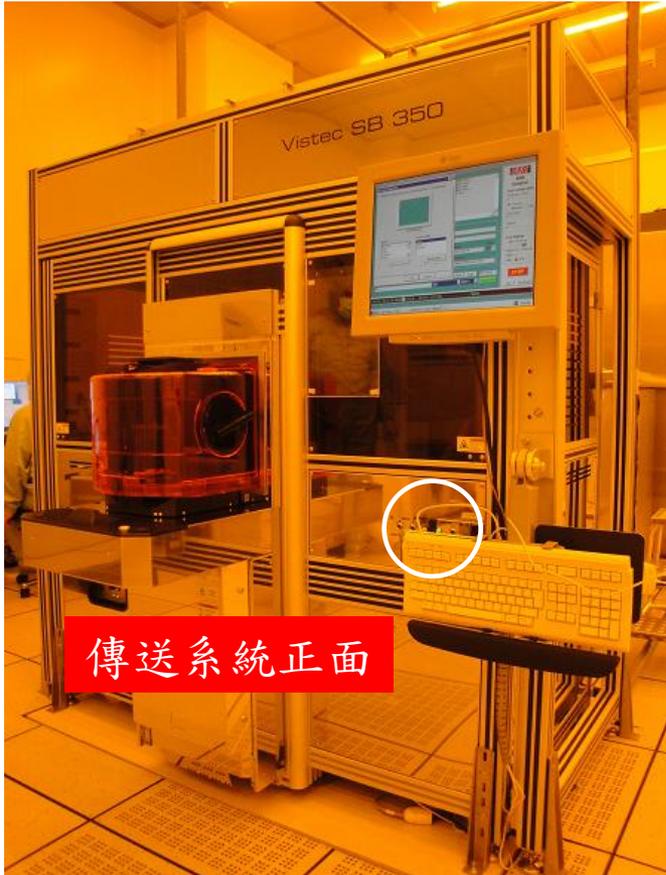
<b>Electron beam shape</b>	<b>Variable shaped beam</b>
<b>Acceleration voltage</b>	<b>50 kV</b>
<b>Min. address grid</b>	<b>1 nm</b>
<b>Current density</b>	<b>15 A/cm<sup>2</sup></b>
<b>Substrate size</b>	<b>200 mm wafer</b>
<b>Min. feature size</b>	<b>&lt; 50 nm</b>

# 設備概觀

**NAR**Labs



# 緊急停機開關-EMO **NAR Labs**



# 服務內容

---

- 8吋晶圓曝光作業
- 搭配設備：
  - L17 阻劑塗佈及顯影系統

END